# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-285022

(43)Date of publication of application: 16.11.1989

(51)Int.CI.

G11B 5/845

(21)Application number: 63-113995

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

10.05.1988

(72)Inventor: KOSHIKAWA YOSHIO

WAKABAYASHI HIROAKI

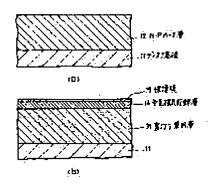
KIUCHI KATSUMI

# (54) PRODUCTION OF PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the production process, to improve the yield thereof and to reduce the cost thereof by subjecting an NiP plating layer formed on the surface of a nonmagnetic substrate to a heat treatment to impart soft magnetization thereto, thereby forming a combined back lining layer in common use as a soft magnetic back lining laver.

CONSTITUTION: This recording medium is constituted by subjecting the NiP layer 12 to at least one time of the heat treatment at 300° C to impart the soft magnetization thereto and to commonly provide the function as the combined back lining layer 31 thereto prior to formation of a perpendicular magnetic recording layer 14 on the nonmagnetic substrate 11 provided with the NiP layer 12 on the surface. The perpendicular magnetic recording layer 14 consisting of Co-Cr having the axis of easy magnetization perpendicular to the combined back lining layer 31 and a protective layer 15 consisting of SiO2, etc., on the surface thereof are



thereafter successively laminated and formed on the surface of the layer 31 by a sputtering method, etc. The need for the stage for forming the soft magnetic back lining layer which is heretofore provided on the NiP plating layer 12 is thereby eliminated and the production process is shortened.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# ⑲日本国特許庁(JP)

11)特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-285022

®Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月16日

G 11 B 5/84 5/845

B-6911-5D A-6911-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

9発明の名称 垂直磁気記録媒体の製造方法

②特 顧 昭63-113995

❷出 願 昭63(1988)5月10日

@発明者越川 誉生

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発明者 若林 弘晃

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@ 希明者 木内 克己

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

勿出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

**19**代理人 弁理士 井桁 貞一

#### 明 福 書

#### 1. 発明の名称

垂直磁気記録媒体の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

表面にNi P めっき層(12)を設けてなる非磁性基板(11)上に、垂直磁気記録層(14)を形成するに先立って、

上記Ni P めっき層(12)を 300で以上の温度で、少なくとも一回熱処理を行って軟磁性化し、裏打ち兼用層(31)とすることを特徴とする垂直磁気記録媒体の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (概 要)

磁気ディスク装置に用いられる2層膜構造の垂 直磁気記録媒体の製造方法に関し、

垂直磁気記録媒体を構成する積層膜数を、その 機能を損なうことなく合理的に減少させて、製造 工程を短縮することを目的とし、 表面にNiPめっき磨を設けてなる非磁性基板上に、垂直磁気記録階を形成するに先立って、前記NiPめっき層を 300で以上の温度で、少なくとも一回熱処理を行って軟磁性化し、裏打ち兼用層とした構成とする。

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気ディスク装置に用いられる垂直磁 気記録媒体の製造方法に関するものである。

軟磁性裏打ち層と垂直磁気記録層からなる2層 膜構造の垂直磁気記録媒体の製造においては、一般的な水平磁気記録媒体に比べて積層膜数が多い ことから製造工程が増加し、歩留りが低下する傾 向があり、このため、そのような製造工程の短縮 が要望される。

#### 〔従来の技術〕

従来の垂直磁気記録媒体は第3図に示すように、 例えばアルミニウム(All)、 成いはガラスなどか らなる非磁性のディスク基板11の表面に、Ni P メ (2)

ッキ表面処理によりNi Pメッキ圏12を形成し、そのNi Pメッキ圏12上にスパッタリング法等によってパーマロイ(Ni-Fe) などからなる軟磁性裏打ち圏13と、該裏打ち圏13に対して垂直な磁化容易軸を有する Co-Crからなる垂直磁気記録層14と、その表面にSiO\*などからなる保護膜15とを順に積層形成することによって構成している。

そして情報の記録・再生は第4図に示すように、 かかる垂直磁気記録媒体21に対向して周知の垂直 磁気記録再生用磁気へッド22を配置して行う。

即ち情報記録には、情報に応じて磁化された主 磁を23の先端から矢印で示すように対向する選直 磁気記録媒体面に対して垂直に磁界を発生するこ とにより、磁気記録層14を垂直に磁化し、その 界は軟磁性裏打ち層13中を水平方向に経由し、再 び磁気記録層14を通過して対向に経由し、再 び磁気記録層14を通過して対向に経由と4を 経て前記主磁極23へ帰還する磁化を再生するにはより 前記記録媒体21の磁気記録層14からの漏洩磁界に より前記磁気へッド22の主磁極23が磁化され、こ

構成する積層膜数を、その機能を損なうことなく 合理的に減少させて製造工程を短縮した新規な垂 直磁気記録媒体の製造方法を提供することを目的 とするものである。

# (課題を解決するための手段)

本発明は上記した目的を達成するため、表面に NiPめっき層を設けてなる非磁性基板上に、垂直 磁気記録層を形成するに先立って、前記NiPめっ き層を 300で以上の温度で、少なくとも一回熱処 理を行って軟磁性化し、裏打ち兼用層としての機 能を兼ねさせた構成とする。

#### (作用)

本発明の垂直磁気記録媒体の製造方法では、非磁性基板上に該基板表面を強化し、かつ平滑化するために施しているEIPめっき層が、 300でよりも高い温度で無処理すると軟磁性化されることに着目して、当該EIPめっき層を前記熱処理により軟磁性化させて、軟磁性裏打ち層としての役割も

の時、前記ヘッド22の薄膜コイル25に発生する信 号電波によって再生が行われる。

以上のように従来の垂直磁気記録媒体21における前記軟磁性裏打ち暦13は、第4図に示すように垂直磁気記録暦14を磁化した磁束がその裏面で短路する層となり、該垂直磁気記録暦14の裏面に発生する分極磁荷を抑制し、かつ垂直減磁界を減らすことによって媒体磁化の減少を防ぎ、更に記録再生時には上述したように記録再生磁気へっら、記録取のリターンパスが形成されることから、記録再生効率を向上させる機能を担っている。

### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記した従来の2階膜構造の垂直磁気記録媒体では水平磁気記録媒体に比べて、前記軟磁性裏打ち層13などによる積層膜数が多いことから製造工程が長くなり、これに起因して製造歩智りの低下及び製造コストが増加するといった問題があった。

本発明は上記した従来の問題点に置み、媒体を

兼ねさせている。従って、従来設けていた軟磁性 裏打ち層の形成工程を省略することができ、当該 製造工程が合理的に短縮される。

#### (実施例)

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に説明する。

第1図(a)及び(b)は本発明に係る垂直磁気記録媒体の製造方法を工程順に示す要部断面図であり、 第3図と同等部分には同一符号を付している。

先ず第1図(a)に示すように、例えばアルミニウム(A L)、或いはガラスなどの非磁性のディスク 基板11表面にNi P メッキ表面処理によりNi P メッ キ暦12を形成し、そのNi P メッキ届12を平面ポリ ッシュ工程により平滑面化を行う。

次に第1図DDに示すように前記平滑面化された NiPメッキ層12を 300でよりも高い温度、例えば 320~400での温度で1時間、熱処理を行う。

これによって、第2図の磁気特性(飽和磁束化、 抗磁力)と熱処理温度との関係図を参照して明ら '' ' (3)

かなように、該Ni Pメッキ暦12は軟磁性化し、軟磁性裏打ち層を兼ねる裏打ち兼用暦31をとして形成される。

その後、該兼用層31の表面上にスパッタリング 法等により、前記裏打ち兼用層31に対して垂直な 磁化容易軸を有する Co-Crからなる垂直磁気記録 層14と、その表面にS10<sub>2</sub>などからなる保護膜15と をその頃に積層形成する。

かくすれば、従来、NiPメッキ層上に設けていた軟磁性裏打ち層の形成工程が不要となり、これらの製造工程を合理的に短縮することができる。

なお、以上の実施例ではNiPメッキ層を軟磁性 化するのに、該NiPメッキ層の平面ポリッシュ工 程後に熱処理を行う場合の例について説明したが、 例えばNiPメッキ層の形成直後、或いは垂直磁気 記録層の成膜直前に熱処理を行うようにしてもよ

また上記のように熱処理されたNiPメッキ層は、 その表面上に垂直磁気記録層を被者形成する際に 再度熱処理されるが、該NiPメッキ層の軟磁性化

- 第1図(a)及び(a)は本発明に係る壁直磁気記録媒体の製造方法の一実施例を工程順に示す要部断面図、
- 第2図はNiPめっき層における磁気特性の熱処 理依存性を示す図、
- 第3図は従来の垂直磁気記録媒体の製造方法を 説明するための要部断面図、
- 第4図は従来の垂直磁気記録媒体を説明するための要部断面図である。
- 第1図回及び回において、

11はディスク基板、12はNi P めっき層、 14は垂直磁気記録層、15は保護膜、31は 裏打ち兼用層をそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井 桁 貞 一 写代報

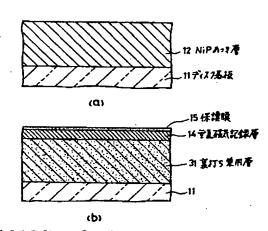
に選影響を及ぼすことはなく、むしろ前記軟磁性 化が磁気特性的にも充実される方向となる効果が ある。

また前記裏打ち兼用層31の表面に微小な凹凸を 形状しておけば、その上に形成される記録層の表面を粗面にすることができるので、当該記録媒体 に対する磁気ヘッド(スライダ)の吸着が減少可能 である。

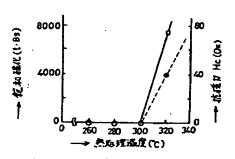
#### (発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明に係る 垂直磁気記録媒体の製造方法によれば、非磁性基 板の表面に形成したNiPめっき層を熱処理により 軟磁性化させて、軟磁性裏打ち層を兼ねる裏打ち 兼用層とすることによって、軟磁性裏打ち層の形 成工程が不要となり、製造工程が大幅に短縮され ると共に、歩留りの向上及び製造コストの低減が 達成できる等、顕著なる効果を奏する。

#### 4. 図面の簡単な説明

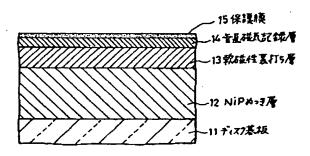


本祭明、全直建筑纪録媒体、弘适方法《工程模·元和号部新面图 第 1 图

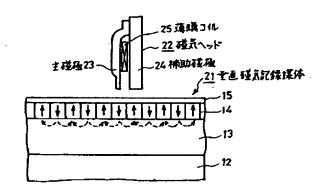


NIPカッス層にあける様式時代の熱皮理依存住を不す団

第 2 図



從未達直碰記錄媒体。製造方法· 铰明 13 零部 新面图 第 3 图



従未A室直碰気記録体 E 鼓明73 零部断面图